

LOR系列半导体芯片光刻胶优良选材操作便捷

产品名称	LOR系列半导体芯片光刻胶优良选材操作便捷
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

KMPR为负性光刻胶，用作DRIE蚀刻掩膜实现高深宽比的图案，它还被广泛用作MEMS与生物器件的电镀模具。因为KMPR减少了Cross-link密度，在Hard baked之前，KMPR比SU-8更容易剥离。KMPR负性光刻胶可在任何(PGMEA),或(TMAH)的显影剂中得到显影。

KMPR 1000系列的特性

- 1) 临时或的应用程序
- 2) 膜厚：2-75 um
- 3) 兼容标准水性显影剂

4) 高宽比成像和垂直侧壁，深宽比： $>5:1$

5) 单一旋涂可达100微米

6) 减少开裂

7) 优异的金属粘附性

8) 优异的电镀膜液稳定性